

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第3部門第1区分  
 【発行日】平成21年3月19日(2009.3.19)

【公表番号】特表2008-531450(P2008-531450A)  
 【公表日】平成20年8月14日(2008.8.14)  
 【年通号数】公開・登録公報2008-032  
 【出願番号】特願2007-557110(P2007-557110)  
 【国際特許分類】

C 0 1 B 3/06 (2006.01)  
 H 0 1 M 8/06 (2006.01)  
 H 0 1 M 8/04 (2006.01)  
 H 0 1 M 8/10 (2006.01)

【F I】

C 0 1 B 3/06  
 H 0 1 M 8/06 R  
 H 0 1 M 8/06 G  
 H 0 1 M 8/04 J  
 H 0 1 M 8/04 L  
 H 0 1 M 8/04 N  
 H 0 1 M 8/10

【手続補正書】

【提出日】平成21年1月26日(2009.1.26)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

反応室部と、

第1の反応物を有する貯蔵部と、

上記貯蔵部を上記反応室部に結合する流れ制御装置とを有し、

上記第1の反応物が上記貯蔵部から上記反応室部へ上記流れ制御装置を介して搬送されて反応してガスを生成し、かつ、上記反応室部の圧力が予め定められた停止圧力を越えるときに上記流れ制御装置が上記第1の反応物の搬送を停止し、

上記流れ制御装置は、当該流れ制御装置の少なくとも一部を、上記第1の反応物の搬送を可能にする第1の位置、または上記反応物の搬送を阻止する第2の位置へバイアスするバネ部材を有することを特徴とするガス発生装置。

【請求項2】

上記第1の反応物は毛細管現象により上記反応室部へ搬送される請求項1記載のガス発生装置。

【請求項3】

上記流れ制御装置は上記反応室部中に配された芯材部材に取り外し可能に結合できる芯材配管を有し、上記反応室部は第2の反応物を内包する請求項2記載のガス発生装置。

【請求項4】

上記芯材配管は、上記貯蔵部に内包された上記第1の反応物と接触する第1の端部と、上記芯材部材と接触して上記貯蔵部から上記反応室部への流路を形成することが可能な第2の端部とを有する請求項3記載のガス発生装置。

## 【請求項 5】

上記芯材配管の上記第 2 の端部は上記パネ部材によって上記芯材部材に接触するようにバイアスされる請求項 4 記載のガス発生装置。

## 【請求項 6】

上記芯材配管の上記第 1 の端部の近傍に結合可能な重りをさらに有する請求項 4 記載のガス発生装置。

## 【請求項 7】

上記第 2 の端部は非透過性部材により支持される請求項 4 記載のガス発生装置。

## 【請求項 8】

上記第 1 の反応物は圧力下で上記反応室部へ搬送される請求項 1 記載のガス発生装置。

## 【請求項 9】

上記流れ制御装置は、第 1 のバルブを有し、上記第 1 のバルブは、上記貯蔵部内の圧力が上記反応室部内の圧力より大きいときに開となって上記反応物を上記貯蔵部から上記反応室部へ搬送するようになされ、または上記第 1 のバルブは、上記反応室部内の圧力が上記貯蔵部内の圧力より小さい予め定められた差分内にあるときに、閉となる上記請求項 8 記載のガス発生装置。

## 【請求項 10】

上記流れ制御装置は、隔膜を有し、上記隔膜は、上記貯蔵部内の圧力が上記反応室部内の圧力より大きいときに開となって上記反応物を上記貯蔵部から上記反応室部へ搬送するようになされ、または、上記隔膜は、上記反応室部内の圧力が上記貯蔵部内の圧力より小さい予め定められた範囲内にあるときに、閉となる請求項 8 記載のガス発生装置。

## 【請求項 11】

ガスの発生を開始させる開始装置をさらに有する請求項 1 記載のガス発生装置。

## 【請求項 12】

上記流れ制御装置は、上記反応物を上記貯蔵部から上記反応室部へ搬送可能にする第 1 の位置と、生成されたガスと上記反応室部から搬送可能にする第 2 の位置との間を往復する可動部材を有し、上記可動部材は上記パネ部材によりバイアスされる請求項 1 記載のガス発生装置。

## 【請求項 13】

生成されたガスを開放する遮断バルブをさらに有する請求項 1 記載のガス発生装置。

## 【請求項 14】

上記遮断バルブは閉位置から開位置へと循環してガスの生成を維持させる請求項 13 記載のガス発生装置。

## 【請求項 15】

上記貯蔵部は上記反応室部に取り外し可能に結合できる請求項 1 記載のガス発生装置。

## 【請求項 16】

上記反応室部は加熱されて上記反応物を改質してガスを生成するか、または上記反応室部はガスの生成を支援する少なくとも 1 つの触媒を有する請求項 1 記載のガス発生装置。

## 【請求項 17】

上記貯蔵部は炭化水素、アルコール、または拡張バルーンを有する請求項 1 記載のガス発生装置。

## 【請求項 18】

上記貯蔵部または上記反応室部は開放バルブに結合される請求項 1 記載のガス発生装置。

## 【請求項 19】

バッフルが上記貯蔵部および上記反応室部の間に配置され、上記バッフルは上記反応室部から上記貯蔵部へガスを搬送可能にする請求項 1 または 4 記載のガス発生装置。

## 【請求項 20】

上記バッフルは複数のリブを有し、上記リブの間の間隔が均一でない請求項 19 記載のガス発生装置。

## 【請求項 2 1】

上記リブの間隔は上記反応室部から上記貯蔵部へ方向に沿って減少するか、または、上記リブは複数組のリブを有し、上記組の中でリブの間隔が均一でない請求項 2 0 記載のガス発生装置。

## 【請求項 2 2】

反応室部と、

第 1 の反応物を有する貯蔵部と、

上記貯蔵部を上記反応室部に連結する流れ制御装置とを有し、

上記第 1 の反応物が上記貯蔵部から上記反応室部へ上記流れ制御装置を介して搬送されて反応してガスを生成し、かつ、上記反応室部の圧力が予め定められた停止圧力を越えるときに上記流れ制御装置が上記第 1 の反応物の搬送を停止し、

上記流れ制御装置は、当該流れ制御装置の少なくとも一部を、上記第 1 の反応物の搬送を可能にする第 1 の位置、または上記反応物の搬送を阻止する第 2 の位置へと移動可能である隔膜を有することを特徴とするガス発生装置。